# 利用[Fe/Pt] 多层膜降低 L10-FePt 有序化温度\*

李宝河<sup>12</sup>) 黄 阀<sup>13</sup> 杨 涛<sup>1</sup> 翟中海<sup>1</sup> 朱逢吾<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(北京科技大学材料物理与化学系,北京 100083)
<sup>2</sup>(北京工商大学数理部,北京 100037)
<sup>3</sup>(金日成综合大学物理系,朝鲜平壤)
(2004年8月19日收到 2004年9月6日收到修改稿)

采用直流磁控溅射方法制备了 Fe/Pt 多层膜和 FePt 单层薄膜,再经不同温度真空热处理得到了有序相 L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜.通过 x 射线衍射谱和磁性研究表明,FePt 单层薄膜需要在 500 ℃以上热处理,才能开始有序化转变,而 Fe/Pt 多层膜可以降低 FePt 薄膜有序化温度.[Fe(1.5 nm)/P(1.5 nm)]<sub>3</sub>薄膜在 350 ℃热处理后,有序度已经增加到 0.6, 相应矫顽力达到了 501 kA/m.多层膜化促进有序化在较低的温度下进行,这是由于热处理过程中多层膜界面的消 失提供了有序化过程额外的驱动力.

关键词:L1<sub>0</sub>-FePt 有序相,磁控溅射,有序度,Fe/Pt 多层膜 PACC: 7550S,7570F,6150C

### 1.引 言

超高密度硬盘驱动器近年来得到快速发展, 2003 年报道的实验室演示的最高磁记录面密度已 达到 20.25 Gb/cm<sup>2[1]</sup>.记录密度要进一步提高,必须 减小磁记录单畴颗粒的尺寸.当磁记录面密度达到 155.7 Gb/cm<sup>2</sup> 时,晶粒尺寸应小于 5 nm,此时由于热 稳定性的需要,磁记录材料必需具有更高的磁晶各 向异性能才能克服由于超顺磁效应引起的热退磁现 象.L1<sub>0</sub>-FePt 有序合金具有极高的单轴各向异性能 ( $k_u = 7 \times 10^6$  J/m<sup>3</sup>)<sup>21</sup>,能够满足超高密度磁记录对 热稳定性的需要,成为下一代磁记录介质的首选材 料<sup>[3,4]</sup>.

直接在冷基片上溅射的 FePt 合金薄膜为无序 的 fcc 结构,如图 ((a)所示.图 1(b)为 L1₀-FePt 有序 合金的晶体结构.FePt 有序相的形成需要较高的基 片温度或热处理温度,一般高于 500 ℃<sup>[3]</sup>.这对于磁 记录介质的实用化是一个很大的困难.因此,研究 FePt 低温有序化成为一个重要的研究方向.研究表 明,可以通过 Fe/Pt 单原子层交替沉积<sup>[5]</sup>、Ag 为底 层<sup>[6]</sup>或者加入第三组元<sup>[7]</sup>等方法降低有序化温度. Endo 等<sup>81</sup>报道了利用磁控溅射方法在石英基片上 制备[Fe(2.5 nm)Pt(t nm)]。多层膜,当 Pt 层厚度 与 Fe 层厚度相等时,得到的矫顽力最高,但由于实 验结果有限,对多层膜化降低有序化温度的讨论尚 不够充分.

本文报道利用磁控溅射方法,在普通玻璃基片 上制备了系列 Pt 层与 Fe 层等厚度比的 Fe/Pt 多层 膜以及在相同的条件下制备的 FePt 单层薄膜,然后 在不同温度下真空热处理,比较了两者的有序化过 程和磁性变化,并研究了多层膜调制周期的变化对 样品的磁性和结构的影响.实验结果表明,多层膜的 界面对降低有序化温度起重要作用.



图 1 FePt 合金的晶体结构 (a) 无序 FePt(fcc),(b) 有序 Ll<sub>0</sub>-FeP(fct)

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号 50301002)和北京市科技新星计划(批准号:H020821290120)资助的课题.

#### 2.实 验

采用直流磁控溅射方法制备 Fe/Pt 多层膜,Fe 靶(99.95% 和 Pt 靶(99.95%) 交替溅射沉积在玻璃 基片上.溅射时基片不加热,溅射前本底真空优于 4×10<sup>-5</sup> Pa,溅射时 Ar 工作气压为 0.4 Pa. Fe 和 Pt 的沉积速率分别为 0.076 和 0.079 nm/s.玻璃基片采 用严格的清洗程序进行清洗烘干后使用,溅射时基 片以 18 r/min 的速率旋转.为便于比较,采用完全相 同的溅射条件,利用 Fe 和 Pt 靶共溅射的方法制备 了总厚度与多层膜相同的 FePt 单层膜.

直接溅射的 Fe/Pt 多层膜和 FePt 单层膜经过 300—550 ℃真空热处理,热处理时真空度优于 5×10<sup>-5</sup> Pa,热处理时间均为20 min.

利用 x 射线衍射(XRD)分析样品的结构(Cu K $\alpha$ )利用扫描电子显微镜的 x 射线能量色散光谱 (EDS)分析测量样品的成分,并用等离子体感应原 子发射光谱(ICP-AES)对 EDS 结果进行校对,样品 成分为 Fe<sub>49</sub>Pt<sub>51</sub>.利用 MicroMag2900 型梯度磁强计 (AGM)和 Lakeshore-7410 型振动样品磁强计(VSM) 测量样品的磁性.薄膜沉积速率由台阶仪测厚度来 确定.

#### 3. 结果及讨论

图 2 是 FePt( 40 nm )单层膜在不同温度下真空 热处理 20 min 的 XRD 谱.从图 2 可以看出,在 300— 500 ℃真空热处理后基本仍为无序面心立方( fcc )结 构 在 550 ℃真空热处理后,出现了超晶格衍射峰 ( 001 ) ( 110 )和( 002 )等峰,特别是一些衍射峰发生 了分裂 :fcc 无序结构的( 200 )峰分裂为( 200 )和 ( 002 )峰 ( 202 )峰分裂为( 220 )和( 202 )峰.这意味着 晶格参数 c 发生了变化,晶体结构由 fcc 向 fct 转变, 形成了 FePt-L1<sub>0</sub> 有序结构.( 002 ) ( 202 )峰出现在原 衍射峰的大角度方向,表明晶格参数 c 减小.由 XRD 谱可以看出,FePt 单层膜的有序化转变温度在 500—550 ℃之间.

图 3 给出了[Fe(1.5 nm)/Pt(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜 在 300—400 ℃热处理 20 min 后的 XRD 谱.结果表 明,在 350 ℃热处理后出现了(001)和(110)衍射峰, 而且(200)和(002)峰有分开的迹象.这说明在 350 ℃热处理后,Fe/Pt 多层膜已经开始向有序 fct 结构



(111)

001

图 2 FeP(40 nm)薄膜经不同温度热处理后的 XRD 谱

转变.400 ℃热处理后,样品为 FePt-L1<sub>0</sub> 有序化更加 显著,基本达到单层薄膜 500—550 ℃热处理后有序 化的程度.

利用布拉格公式可计算[Fe(1.5 nm)/Pt(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜的周期厚度  $\Lambda$ ,

$$\Lambda = \frac{\lambda}{2\sin\theta} , \qquad (1)$$

式中, $\lambda$ 为 Cu  $K\alpha$ 射线波长 0.154 nm, $\theta$ 为小角衍射 第一级衍射峰的位置.图 3 中各小图中的内插图为 样品的小角 XRD 谱,由小角衍射峰位置  $\theta$ 算得  $\Lambda = 2.96$  nm.这与实验设计的 3.00 nm 非常接近,说 明我们制备的多层膜周期性很好,而且也验证了磁 控溅射靶的溅射速率测量比较准确.

从小角 XRD 谱还可以看出,在 400 ℃热处理后 小角衍射峰几乎看不到了,说明 Fe 层和 Pt 层原子 互扩散已经相当充分,多层膜的结构基本消失.

图 4 为 FeP( 40 nm )单层薄膜和 Fe( 1.5 nm )/Pt (1.5 nm )]<sub>3</sub>多层膜在不同温度热处理后的磁滞回线 (外场平行于膜面).FePt 薄膜矫顽力的大小主要由 FePt 有序化的程度决定<sup>[9]</sup>,因此从样品矫顽力可以 推断样品有序化程度的高低.由图 4( a )可以看出, FePt 单层膜在 400 ℃处理后矫顽力仅为 23.9 kA/m,

550 °C



图 3 [Fe(1.5 nm)P(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜经不同温度热处理后的 XRD 谱

表现为软磁行为,说明此时样品基本处于无序状态. 当在 500 ℃热处理后,样品的矫顽力有所增加但还



是很小,只有 263 kA/m.550 ℃热处理后的样品表现 出非常强的硬磁行为,矫顽力高达 1035 kA/m,说明 在这个温度下热处理的样品基本上已完全有序化. 由此可以推断,对于 FePt 单层膜,当热处理时间为 20 min 时,有序化转变温度在 500—550 ℃之间.这与 XRD 谱显示的结果是一致的.

图 4(b)表明 [Fe(1.5 nm)/P(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜 在 350 ℃热处理后 样品的矫顽力就达到 501 kA/m, 说明 Fe/Pt 多层膜化有利于有序化的过程在较低的 温度下启动.在 400 ℃热处理后 样品的矫顽力达到 740 kA/m,已经表现出非常强的硬磁行为,也说明有 序化的程度已经比较高了.

图 5 是 Fe(1.5 nm)/P(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜和 FePt (40 nm)单层薄膜有序度参数 S 以及矫顽力 H<sub>e</sub> 与样 品热处理温度 T<sub>a</sub>之间的关系.有序度参数的定义 为<sup>[8]</sup>

$$S^{2} = \frac{1 - (c/a)}{1 - (c/a)_{s_{t}}}.$$
 (2)



这里 (c/a)<sub>s</sub>,为完全有序的 fet 结构的晶格参数之

比,可以从手册上查到(c/a)由图 2 和图 3 求得.由 图 5 可以看出 随着热处理温度的提高 样品的有序 度参数和矫顽力增大,有序度参数和矫顽力的变化 趋势相当一致.这说明有序化程度越高 样品的矫顽 力也越大.[Fe(1.5 nm)/P(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜的有序 化转变温度比 FePt 单层膜低 100 ℃以上.多层膜化 可以降低 FePt-L1<sub>0</sub> 有序相的形成温度.Endo 等<sup>[8]</sup>认 为 这是原子在多层膜界面扩散更快的结果.实际 上 除这种动力学原因外还存在重要的热力学因素. 在临界温度  $T_c$  以下,无序-有序相变的热力学驱动 力是有序相与无序相结合能之差.与单层膜相比,热 处理过程中多层膜界面的消失提供了有序化过程额 外的驱动力.可见多层膜中的界面在热力学和动力 学上都有利于有序化温度的降低.



图 5 [F<sub>4</sub>(1.5 nm)/P(1.5 nm)]<sub>3</sub>多层膜(▲)和单层膜 FeP(■) 有序度参数 S 及矫顽力  $H_c$  随热处理温度  $T_a$  的变化 (a)有序 度 ,(b) 矫顽力

在同样的实验条件下,利用直流磁控溅射方法 制备了[Fe(x)Pt(x)], ,其中x = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 nm,对应n = 40, 20, 13, 10, 8,以保证多 层膜的总厚度为 40 nm 左右.所有样品均在 350 ℃ 热处理 20 min.

- [1] Choe G , Zhou J N , Demczyk B et al 2003 IEEE Trans. Magn. 39 633
- [2] Weller D 2000 IEEE Trans. Magn. 36 10
- [3] Yang T, Kang K, Yu G H et al 2002 J. Phys. D : Appl. Phys. 35 2897
- [4] Wang Y Z, Zhang M C, Qiao Y et al 2000 Acta Phys. Sin. 49 1600(in Chinese ] 王亦忠、张茂才、乔 祎等 2000 物理学报 49 1600]
- [5] Shima T, Monriguchi T, Mitani S et al 2002 Appl. Phys. Lett. 80 288

图 6 给出了样品的矫顽力随  $F_{4}(x)P(x)$ ], 多 层膜中 Fe 层(或 Pt 层)厚度 x 的变化关系.图 6 表 明,当 x = 1.5—2.0 nm 时,样品的矫顽力最大.当 x= 0.5 nm 时,样品的矫顽力只有约 23.9 kA/m,说明 样品在 350 °C热处理后,未发生有序化转变.Kim 和 Shima 等指出,利用磁控溅射方法沉积 FePt 薄膜时 为岛状生长模式<sup>[10,11]</sup>,因此当周期厚度很小时无法 形成连续的 Fe(或 Pt)原子层,样品的性能接近于单 层膜.相反,当半周期厚度大于 2 nm 时,由于单位厚 度内界面的减少,多层膜界面提供的额外驱动力减 少,有序化过程减缓,矫顽力降低.



图 6 [Fe(x)/Pt(x)], 多层膜在 350 ℃热处理 20 min 后的矫 顽力

#### 4.结 论

Fe/Pt 多层膜化可以降低 FePt 薄膜有序化转变 温度.[Fe(1.5 nm)Pl(1.5 nm)]₃薄膜在 350 ℃热处 理 20 min 后,有序度已经增加到 0.6,相应的矫顽力 达到了 501 kA/m.多层膜化促进有序化在较低的温 度下进行,这是由于热处理过程中多层膜界面的消 失提供了有序化过程额外的驱动力.当多层膜的周 期在 3.0—4.0 nm 时,在 350 ℃热处理后可以得到较 高的矫顽力.

- [6] Hsu Y N, Jeong S, Laughlin D E et al 2001 J. Appl. Phys. 89 7068
- [7] Maeda T, Kai T, Kikitsu A et al 2002 Appl. Phys. Lett. 80 2147
- [8] Endo Y, Kikuchi N, Kitakami O et al 2001 J. Appl. Phys. 89 7065
- [9] Takabashi Y K, Hono K, Shima T et al 2003 J. Mgan. Magn. Mater. 267 248
- [10] Kim M G , Shin S C 2002 Appl. Phys. Lett. 80 3802
- [11] Shima T, Takanashi K, Takahashi Y K et al 2002 Appl. Phys. Lett. 81 1050

## Lowering of ordering temperature for L1<sub>0</sub>-FePt in Fe/Pt multilayers \*

Li Bao-He<sup>1</sup><sup>(2)</sup> Hwang Pol<sup>1</sup><sup>(3)</sup> Yang Tao<sup>1</sup> Zhai Zhong-Hai<sup>1</sup> Zhu Feng-Wu<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> (Department of Material Physics and Chemistry, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

<sup>2</sup> (Department of Mathematics and Physics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100037, China)

<sup>3</sup> (Department of Physics , Kim Il Sung University , Pyongyang , DPRK)

(Received 19 August 2004; revised manuscript received 6 September 2004)

#### Abstract

Fe/Pt multilayers and FePt thin films were prepared by DC magnetron sputtering. The as-prepared samples were subjected to vacuum annealing at temperatures in the range of 300—550 °C. The multilayered structure is an effective approach for reducing the ordering temperature of FePt. The ordering parameter S is evaluated to be 0.6, and correspondingly the coercivity is evaluated to be 501 kA/m in [Fe(1.5 nm)/Pk(1.5 nm)]<sub>13</sub> multilayers annealed at 350 °C for 20 min. Relatively low ordering temperature for the multilayer is due to the extra driving force of ordering process caused by the vanishing of the multilayer interface at annealing.

**Keywords** : L1<sub>0</sub>-FePt order phase , magnetron sputtering , ordering parameter , Fe/Pt multilayer **PACC** : 7550S , 7570F , 6150C

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50301002) and the Science and Technology Nova Program of Beijing , China (Grant No. H020821290120).